PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-151325

(43)Date of publication of application: 27.05.2004

(51)Int.CI.

G02F 1/1339

G02F 1/13

(21)Application number: 2002-315859

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

30.10.2002

(72)Inventor: TAKASHIMA NAOKI

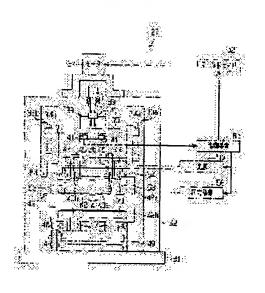
(54) METHOD OF BONDING SUBSTRATES TOGETHER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of bonding substrates together by which a shift in a position and lowering of gap precision are suppressed.

SOLUTION: A substrate W2 is pressurized with the tip of a light guide tube 53 which is arranged in a vacuum chamber 42 for the purpose of partly hardening a sealant, and which is mounted on a pressurizing plate 43a so as to be movable along a direction vertical to the substrate W2, and the sealant is hardened by irradiating the sealant with light from the tip of the light guide tube 53.

可以必要性性的可以不



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2004-151325 (P2004-151325A)

(43) 公開日 平成16年5月27日(2004.5.27)

(51) Int.C1.7

GO2F 1/1339 GO2F 1/13 FΙ

GO2F 1/1339 505 GO2F 1/13 101 テーマコード (参考) 2H088

2H089

審査請求 未請求 請求項の数 5 〇L (全 15 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2002-315859 (P2002-315859) 平成14年10月30日 (2002.10.30)

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(74) 代理人 100068755

弁理士 恩田 博宣

(74)代理人 100105957

弁理士 恩田 誠

(72) 発明者 高島 直樹

愛知県春日井市高蔵寺町二丁目1844番

2 富士通ヴィエルエスアイ株式会社内

Fターム(参考) 2H088 FA03 FA04 FA16 FA17 FA30

MA17 MA20

2H089 MA04Y NA39 NA44 NA45 NA48

NA51 NA60 QA14

(54) 【発明の名称】 基板貼り合せ方法

(57)【要約】

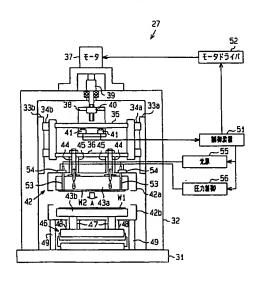
【課題】位置ずれとギャップ精度低下を抑えることのできる基板貼り合せ方法を提供すること。

【解決手段】シール材を部分的に硬化させるため真空チャンバ42内に配置され、加圧板43aに基板W2の垂直方向に沿って移動可能に設けられた導光管53の先端にて基板W2を押圧するとともに該導光管53の先端から光を照射してシール材を硬化させる。

【選択図】

図2

プレス装置の領略構成図



【特許請求の範囲】

【請求項1】

処理室内に配置され互いに対向する第1及び第2の保持板にそれぞれ保持した2枚の基板を位置合せし、該基板を接着剤を介して貼り合わせ、該接着剤を硬化させる基板貼合せ方法であって、

前記接着剤を硬化させるために処理室内に配置され前記保持板に基板の垂直方向に沿って移動可能に設けられた導管の先端にて前記基板を押圧するとともに該導管の先端から光又は熱線を照射して前記接着剤を硬化させることを特徴とする基板貼り合せ方法。

【請求項2】

前記導管は、該導管の先端を前記基板に押圧する圧力を制御する圧力制御部と接続されてなることを特徴とする請求項1記載の基板貼り合せ方法。

【請求項3】

前記導管の先端による前記基板の押圧を保持したまま前記処理室内を大気圧化することを特徴とする請求項1又は2記載の基板貼り合せ方法。

【請求項4】

前記接着剤を硬化した後、前記導管の先端による前記基板の押圧を保持したまま前記保持板の一方を前記基板から離間させることを特徴とする請求項1~3のうちの何れか一項記載の基板貼り合せ方法。

【請求項5】

前記導管に設けられた片当防止機構により該導管の先端面を前記基板に密着させるように 20 したことを特徴とする請求項1~4のうちの何れか一項記載の基板貼り合せ方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は基板貼り合せ方法に係り、詳しくは液晶表示装置(Liquid Crystal Display; LCD)等の2枚の基板を所定の間隔にて貼り合わせた基板(パネル)を製造する際に使用して好適な基板貼合せ方法に関するものである。

[0002]

近年、LCD等の平面表示パネルは、大型化・軽量化(薄型化)が進むとともに、低コスト化の要求が一層高まってきている。このため、2枚の基板を貼り合わせてパネルを製造する装置においては、歩留まりを向上させて生産性を高めることが求められている。

[0003]

【従来の技術】

図10に示すように、液晶表示装置1は、所定の間隔を保持しつつ対向配置されたガラス基板2,3の間に液晶材料4が充填され、上下ガラス基板2,3はシール材5により貼り合せられている。シール材5には、上下ガラス基板2,3の間隔を一定に保つためのスペーサ6が含まれている。液晶材料4は、例えば液晶滴下工法によりシール材5の内側に配置される(例えば、特許文献1参照)。

[0004]

以下、液晶滴下工法について、図11を参照して説明する。

[第1工程]図11(a)に示すように、先ず、上面に塗布されたシール材 5 の内側に液晶材料 4 が滴下された下ガラス基板 3 を、水平方向に移動可能な下テーブル 8 上に図示しない吸着機構により固定する。次に、上ガラス基板 2 を図示しない吸着機構により上テーブル 9 の下面に固定し、該上ガラス基板 2 を下ガラス基板 3 と対向するように所定の間隔で配置する。

[0005]

[第2工程] 図11(b)に示すように、次に、上側容器10と下側容器11とからなる 真空処理室12内の真空引きを行った後、上ガラス基板2を吸着した上テーブル9を所定 の位置まで下降させ、下ガラス基板3を搭載した下テーブル8を水平移動して、下ガラス 基板3と上ガラス基板2との位置合わせを行う。 40

30

[0006]

[第3工程]図11(c)に示すように、次に、上ガラス基板2を吸着させた上テーブル9を降下させて上ガラス基板2をシール材5及び液晶材料4を介して加圧し、上ガラス基板2と下ガラス基板3とを貼り合せる。

[0007]

[第4工程] 図11 (d) に示すように、上テーブル9を上ガラス基板2から離間させ、該上テーブル9に設けた光源13 (又は外部に設けた光源から光ファイバにて真空処理室12内に導かれた光)により、シール材5を部分的に硬化させ、仮止めを行う。

[0008]

[第5工程]図11(e)に示すように、仮止めした上下ガラス基板2,3を真空処理室12から硬化装置15へ搬送し、該硬化装置15の光源16にて上下ガラス基板2,3の全面に光を照射し、未硬化部分を硬化させる。

[0009]

尚、[第4工程]において、図11(f)に示すように、貼り合せた上下ガラス基板2,3を真空処理室12から仮止装置17〜搬出し、該仮止装置17の光源18にてシール材5を部分的に硬化させて仮止めした後、仮止めした上下ガラス基板2,3を[第5工程]へ搬送する製造ラインもある。

[0010]

【特許文献1】

特開2002-229044号公報

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、真空処理室12内で仮止めする工法(製造ライン)では、シール材 5 の硬化させる部分に対応して上テーブル 9 には硬化光を上ガラス基板 2 に導くための孔が形成されている。このため、その孔の部分は上下ガラス基板 2 、3 を加圧することができないので、仮止めする部分での上下ガラス基板 2 、3 の間隔(ギャップ)の精度低下を招いていた

[0012]

真空処理室12外で仮止めする(仮止装置17を設けた)工法(製造ライン)では、真空処理室12内を大気圧化するときや真空処理室12から仮止装置17へ搬送するときに位置ずれ(上下ガラス基板2,3の相対的なずれ)を起こすことがあり、液晶表示装置1の歩留まり低下を招いていた。

[0013]

[第2工程]において、真空処理室12内を真空引きするため、上ガラス基板2を静電吸着により上テーブル9に保持している。従って、[第4工程]において、上テーブル9を静電除去した後、該上テーブル9を上昇させている。

[0014]

しかしながら、上ガラス基板 2 を保持する上テーブル 9 の面の平面度が非常に高精度であるため、上テーブル 9 を静電除去しても、図 1 2 (a)に示すように、上下ガラス基板 2 , 3 が上テーブル 9 に付着したまま上昇する、即ち下ガラス基板 3 が下テーブル 8 と離間してしまうことがある。この場合、上下ガラス基板 2 , 3 を真空処理室 1 2 から搬出するのに手間がかかりラインが停止する。そして、上下ガラス基板 2 , 3 を上テーブル 9 から剥離する際に位置ずれを起こすことがある。また、図 1 2 (b)に示すように、上ガラス基板 2 が上テーブル 9 と共に上昇して下ガラス基板 3 から剥離してしまうことがあった。結果として、仮止めに必要なタクトタイムの長期化を招いていた。

[0015]

本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は貼り合せ基板の位置ずれとギャップ精度低下を抑えることのできる基板貼り合せ方法を提供することにある。

[0016]

50

10

20

30

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明は、処理室内に配置され互いに対向する第1及び第2の保持板にそれぞれ保持した2枚の基板を位置合せし、該基板を接着剤を介して貼り合わせ、該接着剤を硬化させる基板貼合せ方法であって、前記接着剤を硬化させるために処理室内に配置され前記保持板に基板の垂直方向に沿って移動可能に設けられた導管の先端にて前記基板を押圧するとともに該導管の先端から光又は熱線を照射して前記接着剤を硬化させる。従って、基板間の間隔が導管により保持されて接着剤が硬化され、基板間のギャップ精度低下が防止される。

[0017]

請求項2に記載の発明のように、前記導管は、該導管の先端を前記基板に押圧する圧力を 制御する圧力制御部と接続されてなる。

請求項3に記載の発明のように、前記導管の先端による前記基板の押圧を保持したまま前記処理室内を大気圧化する。従って、大気圧化するときの基板のずれが防止される。また、接着剤の硬化後に大気圧化する場合に比べてタクトタイムが短くなる。

[0018]

請求項4に記載の発明のように、前記接着剤を硬化した後、前記導管の先端による前記基板の押圧を保持したまま前記保持板の一方を前記基板から離間させる。従って、離間させる保持板への基板の付着が防がれる。

[0019]

請求項5に記載の発明のように、前記導管に設けられた片当防止機構により該導管の先端面を前記基板に密着させるようにした。従って、片当りによる基板の破損が防止される。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した一実施の形態を図1~図8に従って説明する。

図 1 は、液晶表示装置の製造工程のうち、セル工程における液晶注入及び貼り合せを行う 工程を実施する貼合せ基板製造装置の概略構成図である。

[0021]

貼合せ基板製造装置21は、供給される2種類の基板W1,W2の間に液晶を封止して液晶表示パネルを製造する。尚、本実施形態の装置にて作成される液晶表示パネルは例えばアクティブマトリクス型液晶表示パネルであって、第1の基板W1は、ガラス基板上にTFT等が形成されたアレイ基板(TFT基板)、第2の基板W2はガラス基板上にカラーフィルタや遮光膜等が形成されたカラーフィルタ基板(CF基板)である。これらの基板W1,W2は、それぞれの工程によって作成され供給される。

[0022]

貼合せ基板製造装置21は、制御装置22と、それが制御するシール描画装置23と液晶滴下装置24と貼合装置25と検査装置26を含む。貼合装置25は、プレス装置27と硬化装置28とから構成され、それら装置27,28は制御装置22により制御される。また、貼合せ基板製造装置21は、供給される基板W1,W2を搬送する搬送装置29a~29dを制御し、基板W1,W2とそれにより製造された貼合せ基板を搬送する。

[0023]

第1及び第2の基板W1, W2は、シール描画装置23に供給される。シール描画装置23は、第1及び第2の基板W1, W2のうち何れか一方(本実施形態では第1の基板W1:アレイ基板)の上面に、周辺に沿って所定位置に接着剤としてのシール材を枠状に塗布する。シール材には、少なくとも光硬化性接着剤を含む接着剤が用いられる。そして、基板W1, W2は搬送装置29aに供給され、搬送装置29aは基板W1, W2を1組にして液晶滴下装置24に搬送する。

[0024]

液晶滴下装置24は、搬送された基板W1, W2のうちシール材が塗布された基板W1の上面の予め設定された複数の所定位置に液晶を点滴する。液晶が点滴された基板W1及び

20

30

40

基板W2は、搬送装置29bによりプレス装置27に搬送される。

[0025]

プレス装置27は処理室としてのチャンバを備え、そのチャンバ内には基板W1,W2をそれぞれ吸着保持する保持板としてのチャックが設けられている。プレス装置27は、搬入された基板W1,W2をそれぞれ下側チャックと上側チャックとに吸着保持した後、チャンバ内を真空排気する。そして、プレス装置27は、チャンバ内に所定のガスを供給する。供給するガスは、PDP(Plasma Display Panel)のための励起ガス等の反応ガス、窒素ガス、クリーンドライエアーなどの不活性ガスを含む置換ガスである。これらガスにより、基板や表示素子の表面に付着した不純物や生成物を反応ガスや置換ガスに一定時間さらす前処理を行う。

[0026]

この処理は、貼り合わせ後に開封不可能な貼り合わせ面の性質を維持・安定化する。第1及び第2の基板W1、W2は、それらの表面に酸化膜等の膜の生成や空気中の浮遊物が付着により、表面の状態が変化する。この状態の変化は、基板毎に異なるため、安定したパネルを製造できなくなる。従って、これら処理は、膜の生成や不純物の付着を抑える、また付着した不純物を処理することで基板表面の状態変化を抑え、パネルの品質の安定化を図っている。

[0027]

次に、プレス装置27は、位置合せマーク(アライメントマーク)を用いて光学的に両基板W1、W2の位置合せを非接触にて(少なくとも基板W1上面のシール材に基板W2の下面を接触させることなく)行う。そして、プレス装置27は、両基板W1、W2に所定の圧力を加え、後述する所定の基板間隔(少なくとも両基板W1、W2にシール材が密着する間隔)となるまでプレスした後、チャンバ内を大気開放する。これにより、両基板W1、W2は、大気圧と基板W1、W2間との圧力差により、所定のセル厚(セルギャップ)とする最終の基板間隔まで圧縮される。

[0028]

尚、制御装置22は、両基板W1、W2のプレス装置27内への搬入からの時間経過を監視し、プレス装置27内に供給したガスに第1及び第2の基板W1、W2を暴露する時間(搬入から貼合せを行うまでの時間)を制御する。これにより、貼り合せ後に開封不可能な貼合せ面の性質を維持・安定化する。

[0029]

搬送装置29 c は、プレス装置27内から貼り合わされた液晶パネルを取り出し、それを硬化装置28 へ搬送する。この時、制御装置22は、液晶パネルをプレスしてからの時間経過を監視し、予め定めた時間が経過すると搬送装置29 c を駆動して基板を硬化装置28 に供給する。硬化装置28は、搬送された液晶パネルに所定の波長を有する光を照射し、シール材を硬化させる。

[0030]

即ち、貼り合わせ後の基板は、プレスから所定時間経過後にシール材を硬化させるための 光が照射される。この所定時間は、液晶の拡散速度と、プレスにより基板に残留する応力 の解放に要する時間により予め実験により求められている。

[0031]

プレス装置27により基板W1,W2間に封入された液晶は、プレス及び大気開放によって拡散する。この液晶の拡散が終了する、即ち液晶がシール材まで拡散する前に、そのシール材を硬化させる。

[0032]

更に、基板W1, W2は、プレスにおける加圧等により変形する。搬送装置29cにより搬送中の貼り合わせ基板(液晶パネル)は、シール材が硬化されていないため、基板W1, W2に残留する応力は解放される。従って、シール材の硬化時には残存する応力が少ないため、位置ズレが抑えられる。

[0033]

50

10

20

30

20

30

40

シール材が硬化された液晶パネルは搬送装置 2 9 d により検査装置 2 6 に搬送される。検査装置 2 6 は、搬送された液晶パネルの基板 W 1 、 W 2 の位置 ズレ (ずれている方向及びズレ量) を測定し、その測定値を制御装置 2 2 に出力する。

[0034]

そして、制御装置 2 2 は、検査装置 2 6 の検査結果に基づいて、プレス装置 2 7 における位置合せに補正を加える。即ち、シール材が硬化した液晶パネルにおける両基板W 1, W 2 のズレ量をその位置ズレ方向と反対方向に予めずらしておくことで、次に製造される液晶パネルの位置ズレを防止する。

[0035]

次に、プレス装置27について説明する。

図2は、基板W1, W2へ圧力を加えて貼り合わせを行うプレス装置27の機構を側面から見た概略図である。

[0036]

プレス装置27は、ベース板31及びそのベース板31に固定されたゲート状の支持枠32を備えている。これらベース板31及び支持枠32は十分に高い剛性を持つ材質により形成されている。その支持枠32の支柱部内側面には、両側にガイドレール33a,33bが取着され、それによってリニアガイド34a,34bが上下動可能に支持されている。両側のリニアガイド34a,34bの間には、第1及び第2の支持板35,36が掛け渡され、第1の支持板35は、支持枠32の上部に取り付けられたモータ37によって上下動する第3の支持板38により吊り下げられている。

[0037]

詳述すると、モータ37の出力軸にはボールネジ39が一体回転可能に連結され、そのボールネジ39には第3の支持板38に設けられたナット40が螺合されている。従って、モータ37が駆動されボールネジ39が正逆回転することにより、第3の支持板38が上下動する。第3の支持板38はコ字状に形成され、その上部側の板にナット40が設けられている。第3の支持板38の下部側の板上面には複数(本実施形態では例えば4つ)のロードセル41が取着され、そのロードセル41の上に第1の支持板35の下面が当接されている。

[0038]

プレス装置 2 7 は、支持枠 3 2 の支柱部内側に処理室としての真空チャンバ4 2 を備え、そのチャンバ4 2 は上下に分割され、上側容器 4 2 a と下側容器 4 2 b とから構成されている。そして、このチャンバ4 2 内には、基板W1, W2を吸着保持するためのチャック機構を有した第1及び第2の保持板としての加圧板 4 3 a 及びテーブル 4 3 b が対向して設けられている。尚、本実施形態では、加圧板 4 3 a は第2 の基板W2 (CF基板)を保持し、テーブル 4 3 b は第1 の基板W1 (TFT基板)を保持する。

[0039]

加圧板 4 3 a は上側容器 4 2 a 内に設けられ、第 2 の支持板 3 6 に吊下支持されている。 詳述すると、第 2 の支持板 3 6 には所定位置に上下方向に貫通した複数(本実施形態では例えば 4 つ)の孔が形成され、それら各孔に支柱 3 4 が挿通されている。各支柱 3 4 は上端が拡径されて下方向へ抜けないように形成され、その下端に加圧板 4 3 a が取着されている。即ち、加圧板 4 3 a は 4 本の支柱 4 4 により第 2 の支持板 3 6 に吊下支持されている。

[0040]

第2の支持板36と上側容器42aとの間には、上記各支柱44を囲みチャンバ42の気密を保つための弾性体としてのベローズ45が設けられている。そして、上側容器42aは、ベローズ45を介して第2の支持板36に吊下支持される。

[0041]

テーブル43bは下側容器42b内に設けられ、位置決めステージ46に支持されている。詳述すると、位置決めステージ46は、ベース板31に固定設置され、該ステージ46 上の所定位置に取着された複数の支柱47によりテーブル43bを支持する。この位置決

20

30

40

50

めステージ 4 6 は、テーブル 4 3 b を水平方向(X 方向及びY 方向)に移動させる機構及び水平回転(θ 方向)させる機構を有している。

[0042]

位置決めステージ46と下側容器42bとの間には、上記各支柱47を囲みチャンバ42の気密を保つためのベローズ48が設けられている。下側容器42bの下面には、ベース板31上に立設された複数の支持部材49が取着されている。そして、下側容器42bは、支持部材49を介してベース板31に支持されている。

[0043]

上記加圧板43aを吊下支持する各支柱44の上端と第2の支持板36との間にはレベル(平行度)調整部(図示略)が設けられている。レベル調整部は例えば支柱44に形成されたネジと螺合するナットであり、これを正逆回転させることで支柱44を上昇又は下降させ、加圧板43aの水平レベルを調整する。例えば、加圧板43aとテーブル43bとの平行度は、レベル調整部により50μm以下になるように調整される。

[0044]

このように構成されたプレス装置27では、モータ37が駆動して第3の支持板38が上下動すると、ロードセル41、第1の支持板35を介してリニアガイド34a,34bがガイドレール33a,33bに沿って上下動し、第2の支持板36、ベローズ45を介して上側容器42aが上下動する。従って、リニアガイド34a,34bの下降方向にモータ37が回転されると、上側容器42aと下側容器42aと下側容器42aと下側容器42bとがシールされ、チャンバ42が閉塞される。そして、この状態で、さらにリニアガイド34a,34bの下降方向にモータ37が回転されると、上記ベローズ45は押圧され、第2の支持板36、支柱44を介して加圧板43aのみが下降する。これにより、プレス装置27は、加圧板43a及びテーブル43bに保持した基板W2,W1に加工力を加えて貼り合わせを行う。

[0045]

その貼り合わせ時において、ロードセル41(4つ)は、該ロードセル41に作用する圧力を検出し、その検出結果をプレス装置27の制御装置51に出力する。その圧力は、第3の支持板38に支持された部材(第1の支持板35、リニアガイド34a,34b、第2の支持板36、支柱44、レベル調整部40、加圧板43a、基板W2)の重量(自重)Aと、支柱44の断面積に比例して加圧板43aに作用する大気圧力Bとの荷重の総和(A+B)である。

[0046]

このロードセル41に加わる圧力の総和は、モータ37を駆動して加圧板43aを下降させることで両基板W1, W2を貼り合わせるときに、その基板W1, W2による反力によって減少する。従って、このように各ロードセル41が検出する圧力の総和値が減少することにより、実際に基板に加わるその時々の荷重、即ち貼り合わせ時の基板W1, W2の加工圧を知ることができる。

[0047]

制御装置 5 1 は、ロードセル 4 1 から出力される電気信号を変換して各ロードセル 4 1 が 検出した圧力の値を求め、その時々の基板 W 1 、W 2 に加わる荷重(加工圧)を算出する 。そして、制御装置 5 1 は、その時々の加工圧の値に基づいて、基板 W 1 、W 2 に加える 圧力を一定とするように生成したモータ駆動信号を付属するモータコントローラ(図示略)からモータドライバ 5 2 に出力する。モータドライバ 5 2 は、その制御装置 5 1 からの モータ駆動信号に応答して生成した所定の数のパルス信号をモータ 3 7 に出力し、モータ 3 7 はそのパルス信号に応答して回転駆動する。

[0048]

上側容器 4 2 a には、導光管 5 3 が加圧支持部 5 4 により取着されている。導光管 5 3 は、基板 W 1, W 2 を仮止めするために、該仮止めの位置に対応して設けられている。導光管 5 3 は光源 5 5 に接続され、加圧支持部 5 4 は圧力制御部 5 6 に接続されている。光源 5 5 及び圧力制御部 5 6 は制御装置 5 1 により制御される。

40

50

[0049]

図4に示すように、導光管53は、その先端に片当防止機構57を備え、接続部58を介してファイバ59と接続されている。そのファイバ59は、基板W1,W2間のシール材を硬化させるための光を発生する光源55(図2参照)に接続されている。

[0050]

光源 5 5 は、基板 W 1 、 W 2 の仮止め、即ち基板 W 1 、 W 2 間のシール材を硬化させるのに必要な光を発生するものであり、光源 5 5 にて発生した光は、光ファイバ 5 9 を介して導光管 5 3 へと導かれ、該導光管 5 3 から基板 W 1 、 W 2 間のシール材に照射される。

[0051]

加圧支持部54は、導光管53を上下方向(導光管53の先端が基板W1と接離する方向)に沿って移動可能に支持している。即ち、加圧板43aには、基板W1, W2を仮止めする位置に対応して上下方向に貫通した挿通孔が形成され、加圧支持部54は該挿通孔に挿通された導光管53を上下方向に移動可能に支持している。

[0052]

加圧支持部54と圧力制御部56は、導光管53の先端にて基板W2を押圧すると共に、その押圧力(加圧力)を制御するために設けられている。

図 7 に示すように、加圧支持部 5 4 は、固定板 6 1、メタルブッシュ 6 2、ベローズ 6 3、可動板 6 4 を備えている。固定板 6 1 は図 2 の上側容器 4 2 a に固定されている。固定板 6 1 には貫通孔 6 1 a が形成され、該貫通孔 6 1 a には略円筒状に形成され上端にフランジが形成されたメタルブッシュ 6 2 が挿入され、固定板 6 1 とメタルブッシュ 6 2 の間はシールされている。メタルブッシュ 6 2 には導光管 5 3 が挿通されており、該メタルブッシュ 6 2 は導光管 5 3 を上下方向に摺動可能に支持している。メタルブッシュ 6 2 の上面には、該メタルブッシュ 6 2 と導光管 5 3 との間をシールするシール材 6 2 a が固定部材 6 2 b により固定されている。

[0053]

固定板61は、ベローズ63を介して可動板64を吊下支持している。ベローズ63は導光管53を内包するように筒状に形成されている。可動板64には貫通孔64aが形成され、該貫通孔64aには導光管53が挿通されている。可動板64と導光管53の間はシールされている。可動板64には係止片65が設けられ、該係止片65により可動板64に対して導光管53が移動不能に固定されている。

[0054]

固定板61には、該固定板61を貫通しベローズ63の内部と外部とを連通する管路66が形成されている。固定板61の上面には、管路66と図6に示す圧力制御部56と接続するための継手67が設けられている。

[0055]

図6に示すように、圧力制御部56は、レギュレータ71,72、電空レギュレータ73、電磁弁74,75、残圧排気弁76、真空レギュレータ77、圧力検出器78を備えている。

[0056]

第1レギュレータ71は、所定圧力の気体(例えば、工場内で使用される高圧(O. 7M Pa以上)の気体)が供給されている。第1レギュレータ71は、第2レギュレータ72 と電空レギュレータ73とに接続されている。第1及び第2レギュレータ72は、開閉弁 としての機能と、供給される気体の圧力を低減する機能とを有している。第1レギュレー タ71は、電空レギュレータ73及び第2レギュレータ72に対して、所定の第1圧力(本実施形態では O. 5MPa)に調整した気体の供給/停止を行う。第2レギュレータ7 2は、電磁弁74に対して、所定の第2圧力(本実施形態では O M P a)に調整した気体 の供給/停止を行う。

[0057]

電空レギュレータ73は可変圧力制御レギュレータであり、図2の制御装置51からの電気信号に応答して残圧排気弁76を介して第1電磁弁74に出力する気体の圧力を調整す

る。

[0058]

第1電磁弁74は、制御装置51からの電気信号に応答して第2レギュレータ72又は電空レギュレータ73からの気体を第2電磁弁75に供給するように管路を切換える。

[0059]

第2電磁弁75は、制御装置51からの電気信号に応答して、加圧支持部54に対して第 1電磁弁74又は真空レギュレータ77と接続されるように管路を切換える。

[0060]

真空レギュレータ77は、低真空(本実施形態では-70MPa)の能力を持つ真空ポンプ(図示略)に接続され、制御装置51からの電気信号に応答して開閉する弁として働く

10

[0061]

第2電磁弁75と加圧支持部54との間の配管には、圧力検出器78が設けられている。 圧力検出器78は、第2電磁弁75と圧力検出器78との間の配管における圧力を検出し、該圧力に応じた信号を制御装置51に出力する。

[0062]

制御装置 5 1 は、液晶表示装置の製造工程において光源 5 5 及び圧力制御部 5 6 を適宜制御し、導光管 5 3 の先端(詳しくは片当防止機構 5 7)にて基板W 2 を加圧するとともに、導光管 5 3 から光を照射して基板W 1、W 2 間のシール材を硬化して該基板W 1、W 2 を仮止めする。その際、制御装置 5 1 は、圧力検出器 7 8 からの信号に基づいて、各レギュレータ 7 1 ~ 7 3、 7 7 及び電磁弁 7 4、 7 5 を切換え制御する。

20

[0063]

待機状態において、加圧支持部54は第2電磁弁75により真空レギュレータ77と接続されている。従って、加圧支持部54のベローズ63内は低真空になっているため、該ベローズ63が収縮して導光管53先端が加圧板43a内に収容されている。

[0064]

導光管53を下降させるため、先ず第2電磁弁75を第1電磁弁74と接続し、加圧支持部54を0MPaと接続する。これは、電空レギュレータ73と加圧支持部54を接続するための前準備であり、電空レギュレータ73と真空回路とを直結するのを防ぐ。これは、電空レギュレータ73が真空対応ではないためであり、電空レギュレータ73を保護するためである。

30

[0065]

次に、第1電磁弁74を電空レギュレータ73と接続し、電気信号にて電空レギュレータ73の出力圧力を調整する。この電空レギュレータ73の出力圧力により加圧支持部54のベローズ63内が加圧され、該ベローズ63が延びて導光管53が下降し、該導光管53の先端にて基板W2を加圧する。導光管53を上昇させる場合には、上記下降の場合と逆の操作を行う。

[0066]

そして、制御装置51は、導光管53にて基板W2を加圧した状態で、光源55にて発生させた光を導光管53を介して基板W1、W2間のシール材に照射する。この光の照射によってシール材が部分的に硬化し、基板W1、W2が仮止めされる。

40

[0067]

図5 (a) に示すように、片当防止機構57は、当接部81と押圧部82とから構成されている。当接部81は、導光管53の先端を覆う略有底筒状に形成され、その底部に光を透過させるための導出孔81 aが形成されている。当接部81の内周面には係止部81 bが周方向に沿って形成されている。

[0068]

導光管53の外周面には、その周方向に沿って延びる2条の溝が形成され、該溝にはO状の弾性部材としてのリング83、84が装着されている。当接部81は、係止部81bが 先端側のリング83よりの反先端側に配置されるように導光管53の先端に装着される。

20

30

40

そして、当接部81は、リング83、84によって、その内周面と導光管53の外周面とが所定間隔にて離間するとともに、導光管53の先端面から当接部81の底部内面とが所定間隔にて離間するように保持される。

[0069]

押圧部82は略円筒状に形成され、その内径は導光管53の外径と略同一に形成されている。そして、押圧部82は、導光管53の径方向に沿って形成された螺子孔82aに螺入された係止螺子85により導光管53に固定されている。

[0070]

当接部81と押圧部82との互いに軸方向に対向する面の間には、押圧リング86が狭持されている。

この押圧リング86は、上記圧力制御部56による押圧力を当接部81に伝達すると共に、該当接部81にて基板W2を押圧したときに、当接部81と導光管53とが接触するのを防ぐ。即ち、押圧リング86は、押圧力の伝達と接触を防ぐように、その弾力及び断面寸法が設定されている。換言すれば、押圧リング86の形状及び性質(弾性力)により、押圧部82の形状(導光管53と押圧部82との隙間)と押圧部82の取着位置が決定されている。

[0071]

図5(b)に示すように、導光管53が下降すると、先ず、当接部81の先端が基板W2の上面に当接する。この時、導光管53の軸線は、基板W2の垂直線と角度的に一致していないことが多い。従って、当接部81は基板W2に対して片当りを起こしている。尚、導光管53の軸線を基板W2に垂直にすることは、機械精度上難しく、調整によって一致させようとしても完全に一致させることは難しい。片当りを起こしたまま押圧すると、その押圧力が接触した点に集中するため、基板が破損する場合がある。

[0072]

更に、導光管53が下降すると、図5(c)に示すように、当接部81は、導光管53の押圧力によって、導光管53(当接部81)の軸線が傾いている側のリング83,84がつぶれ、当接部81が該導光管53に対して傾き、当接部81の先端面81cが基板W2の上面と密着する。従って、基板W2は、当接部81の先端面により押圧され、基板W2は破損しない。

[0073]

次に、このプレス装置 2 7 のその他の制御機構について図 3 を参照しながら説明する。尚、図 2 で説明した構成と同様の構成部分については同一符号を付してその詳細な説明を一部省略する。

[0074]

上記したように、制御装置 5 1 は各ロードセル 4 1 からの出力を総和して荷重値(荷重の総和値)を算出し、その荷重値に基づいて生成したモータ駆動信号をモータドライバ 5 2 に出力する。モータドライバ 5 2 は、それに応答して生成したパルス信号をモータ 3 7 (図中、加圧板上下モータ)に出力し、これによりモータ 3 7 が加圧板 4 3 a を上昇又は下降させる方向に回転駆動する。

[0075]

また、制御装置 5 1 は、画像処理装置 9 1 からの出力信号に基づいて位置決めステージモータ 9 2 を駆動するためのモータ駆動信号をモータドライバ 9 3 に供給する。詳述すると、プレス装置 2 7 は、基板貼り合わせ時に両基板 W 1 , W 2 の位置合せをするためのアライメントマークを撮像する C C D カメラ 9 4 を備えている。この C C D カメラ 9 4 は、貼り合わせ時に基板 W 1 , W 2 に形成されたアライメントマークを撮像し、その画像データを画像処理装置 9 1 に出力する。制御装置 5 1 は、その画像処理装置 9 1 の演算結果(位置がれ量の算出データ)に応じて生成したモータ駆動信号をモータドライバ 9 3 に出力し、モータドライバ 9 3 は、それに応答して生成した所定の数のパルス信号を位置決めステージモータ 9 2 に出力する。このモータ 9 2 の回転駆動に基づいてテーブル 4 3 b を支持する位置決めステージ 4 6 が駆動され、これにより両基板 W 1 , W 2 の位置合せが行われ

る。

[0076]

本実施形態のプレス装置27を用いた液晶表示装置の製造方法(貼り合せ工法)を図8に従って説明する。尚、液晶表示装置の一部部材については、従来(図9)と同じ符号を用いて説明する。

[0077]

[第1工程] 図8(a)に示すように、先ず、基板W1, W2を真空チャンバ42内に搬入する。即ち、表面に塗布されたシール材5の内側に液晶材料4が滴下された基板W1を、水平方向に移動可能なテーブル43b上に搭載し、その基板W1を図示しない吸着機構によりテーブル43bに吸着固定する。基板W2を図示しない吸着機構により加圧板43aの下面に吸着固定し、両基板W1, W2を対向するように所定の間隔で配置する。この時、圧力制御部56は待機状態にあり、導光管53の先端は加圧板43aに収容されている。

[0078]

[第2工程] 図8 (b) に示すように、次に、真空チャンバ42内の真空引きを行った後、基板W2を吸着した加圧板43aを所定の位置まで下降させ、基板W1を搭載したテーブル43bを水平移動して、基板W1と基板W2との位置合わせを行う。

[0079]

[第3工程] 図8 (c) に示すように、次に、基板W2を吸着させた加圧板43aを降下させて基板W2をシール材5及び液晶材料4を介して加圧し、基板W1に貼りあわせる。

[0080]

[第4工程] 図8 (d) に示すように、次に、圧力制御部56を制御して導光管53を下降させ、両基板W1, W2間の間隔を所定間隔となるように該基板W2上面を押圧し、導光管53先端より光を照射し、シール材5を硬化させ、基板W1, W2の仮止めを行う。そして、導光管53による基板W2の押圧と同時期に真空チャンバ42内を真空から大気に戻す。

[0081]

[第5工程]図8(e)に示すように、導光管53にて基板W2を押圧した状態で加圧板43aを上昇させた後、圧力制御部56を制御して導光管53を上昇させる。

[0082]

[第6工程]図8(f)に示すように、仮止めした両基板W1,W2を真空チャンバ42内から硬化装置28〜搬送し、該硬化装置28にて基板W1,W2間のシール材5全体に光を照射してシール材5を硬化させ、基板W1と基板W2の貼りあわせが完了する。

[0083]

以上記述したように、本実施の形態によれば、以下の効果を奏する。

(1)シール材 5 を部分的に硬化させるため真空チャンバ4 2 内に配置され、加圧板 4 3 a に基板 W 2 の垂直方向に沿って移動可能に設けられた導光管 5 3 の先端にて基板 W 2 を押圧するとともに該導光管 5 3 の先端から光を照射してシール材 5 を硬化させるようにした。その結果、基板 W 1, W 2 間の間隔が導光管 5 3 により保持されてシール材 5 が硬化されるため、基板 W 1, W 2 間のギャップ精度低下を防止することができる。

[0084]

(2) 導光管 5 3 は、該導光管 5 3 の先端を基板W2に押圧する圧力を制御する圧力制御部 5 6 と接続されている。従って、基板W2に対する押圧力を適宜変更することができる

[0085]

(3) 導光管 5 3 の先端による基板W 2 の押圧を保持したまま真空チャンバ 4 2 内を大気圧化するようにした。その結果、大気圧化するときの基板W 1, W 2 の相対的なずれを防止することができる。

[0086]

(4) 導光管53の先端にて基板W2を押圧し、真空チャンバ42内を大気圧かしたため

10

20

30

40

、シール材 5 を硬化した後に真空チャンバ 4 2 内を大気圧化する場合に比べてタクトタイムを短縮することができる。

[0087]

(5)シール材 5 を部分的に硬化した後、導光管 5 3 の先端による基板W 2 の押圧を保持したまま加圧板 4 3 a を上昇させて基板W 2 から離間させるようにした。その結果、加圧板 4 3 a への基板W 1 , W 2 の付着と、基板W 1 から基板W 2 が剥がれるのを防ぐことができる。

[0088]

(6) 導光管53に設けられた片当防止機構57により当接部81の先端面81cを基板W2に密着させるようにした。その結果、片当りによる基板W2の破損を防止することができる。

[0089]

(7) 導光管53を支持する加圧支持部54を上側容器42aに取着した。その結果、加圧板43aを上昇させても、安定した押圧力にて基板W2を導光管53にて押圧することができる。

[0090]

尚、前記実施形態は、以下の態様に変更してもよい。

・本実施形態では光硬化性接着剤を含むシール材 5 を用いたが、熱硬化性接着剤、光+熱硬化性接着剤を含むシール材を用いても良い。その場合、導光管 5 3 から基板 W 1, W 2間のシール材に対して熱線を照射する構成とすればよい。

[0091]

・貼合せ基板製造装置 2 1 の形態は図 1 に示す形態に限定されない。例えば各装置 2 2 ~ 2 4, 2 7, 2 8 は、必要に応じて複数備えられる。

・本実施形態にてチャンバ42は上下に分割して構成されているが、チャンバ42の構造 は本実施形態に限定されるものではなく、例えばゲートを備えたチャンバに適用してもよ い。

[0092]

・本実施形態では、片当防止機構 5 7 を導光管 5 3 の先端に設けたが、それを導光管 5 3 の後端(接続部 5 8 側端部)、先端と後端との間に設けて実施しても良い。

[0093]

・本実施形態において、加圧支持部54の構成を適宜変更して実施しても良い。例えば、図9に示すように、加圧支持部101を構成する。この加圧支持部101は、図7に示す加圧支持部54の構成に加えて、係止部材102と補助スプリング103を有している。係止部材102は導光管53に移動不能に固定され、補助スプリング103は固定板61と係止部材102との間に介挿されている。補助スプリング103は圧縮バネであり、待機状態において、ベローズ63内を低真空にして導光管53の先端を加圧板43a内に収容するのを補助する。

[0094]

【発明の効果】

以上詳述したように、本発明によれば、基板間のギャップ精度を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】基板貼合せ装置の概略構成図である。
- 【図2】プレス装置の概略構成図である。
- 【図3】プレス装置の制御機構を説明するブロック図である。
- 【図4】導光管の外観模式図である。
- 【図5】(a)~(c)は、片当り防止機構の説明図である。
- 【図6】圧力制御部の説明図である。
- 【図7】加圧支持部の説明図である。
- 【図8】(a)~(f)は、本実施形態の製造工程を示す説明図である。
- 【図9】別の加圧支持部の説明図である。

20

10

30

【図10】液晶表示装置の概略構成図である。

【図11】(a)~(f)は、従来の製造工程を示す説明図である。

【図12】(a), (b)は、従来の製造工程を示す説明図である。

【符号の説明】

接着剤(シール材)

42 処理室(真空チャンバ)

53 導管(導光管)

5 4 加圧支持部

5 6 圧力制御部

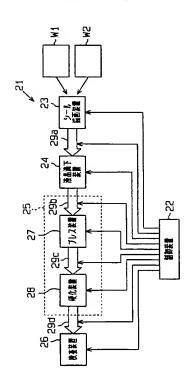
57 片当防止機構

8 1 c 先端面

W 1, W 2 基板

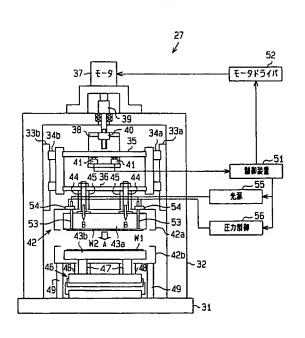
【図1】

基板貼合せ装置の機略構成図



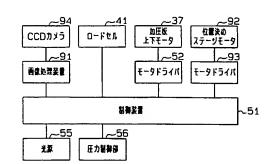
【図2】

プレス装置の概略構成図



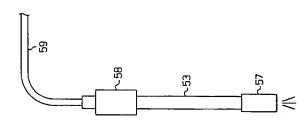
【図3】

プレス装置の制御機構を説明するプロック図



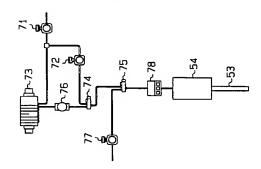
【図4】

導光管の外観模式図



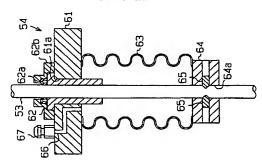
【図6】

圧力制御部の説明図



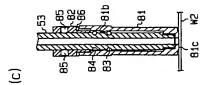
【図7】

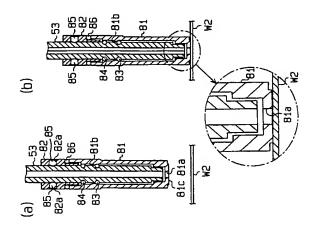
加圧支持部の説明図



【図5】

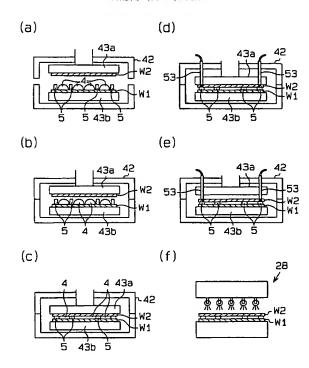
片当り防止機構の説明図





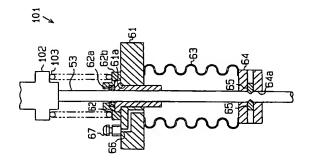
【図8】

本実施形態の製造工程を示す説明図



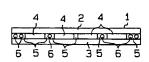
【図9】

別の加圧支持部の説明図



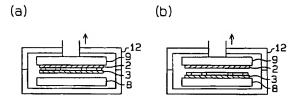
【図10】

液晶表示装置の物略構成図



【図12】

後米の製造工程を示す説明因



【図11】

養来の製造工程を示す説明図

